(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年10 月13 日 (13.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/095352 A1

(51) 国際特許分類⁷: C07D 231/20, 413/12

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/006806

(22) 国際出願日: 2005年3月31日(31.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-102963 2004年3月31日(31.03.2004) JI

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): イハラケミカル工業株式会社 (IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1100008 東京都台東区池之端1丁目4番26号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 内田 幸生 (UCHIDA, Yukio) [JP/JP]; 〒4213306 静岡県庵原郡富 士川町中之郷2256番地 イハラケミカル工業株式会 社 研究所内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 青木 篤, 外(AOKI, Atsushi et al.); 〒1058423 東京都港区虎ノ門三丁目 5 番 1 号 虎ノ門 3 7 森ビ ル青和特許法律事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING 5-HYDROXY-4-THIOMETHYLPYRAZOLE COMPOUND

(54) 発明の名称: 5 - ヒドロキシー4 - チオメチルピラゾール化合物の製造方法

(57) Abstract: A pyrazole compound represented by the general formula (1) is reacted with a sulfur compound represented by the general formula (2) in the presence of a base and formaldehyde to produce a 5-hydroxy-4-thiomethylpyrazole compound represented by the general formula (3). Thus, the 5-hydroxy-4-thiomethylpyrazole compound can be easily and efficiently produced. This process enables the 5-hydroxy-4-thiomethylpyrazole compound to be easily produced in high yield under mild conditions through a single step without the necessity of using any special apparatus, expensive catalyst, transition metal, etc. It is friendly to the environment because it generates substantially no harmful wastes derived from a catalyst, etc. Industrial use of the process is highly valuable.

(57) 要約: 一般式(1)で表されるピラゾール類に、塩基及びホルムアルデヒドの存在下、一般式(2)で表される硫黄化合物を反応させることにより、一般式(3)で表される5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物を製造する。この方法によれば、5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物を簡便に、且つ収率良く製造することができる。また、特殊な装置や高価な触媒、遷移金属等を用いず、簡便かつ穏やかに、単一工程で収率よく5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物を製造でき、且つ、触媒等に由来する有害廃棄物も実質的に生成しないため、環境にも優しく、工業的利用価値が高い。





明 細 書

5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法

技術分野

本発明は、医薬及び農薬の製造中間体として有用な5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法に関するものである。

背景技術

本発明によって得られる5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾ ール化合物は医薬及び農薬の製造中間体として有用である。

4-チオメチルピラゾール化合物の製法としては、4-クロロメ チルピラゾール化合物と硫黄化合物を反応させる方法が知られてい る (特許文献 1 参照)。

この反応の原料として用いられる 4 ークロロメチルピラゾール化合物を得るためには、例えば、対応する βーケトエステル類とヒドラジン類との閉環反応により、一旦、 4 位にメチル基を有するピラゾール化合物を合成した後、このメチル基をクロロ化してクロロメチル基としなければならず、 4 ーチオメチルピラゾール化合物を得るには、 更にこのクロロメチル基を有機硫黄化合物と反応させる必要がある(特許文献 1 参照)。 しかしながら、このような方法では反応が多段階にわたり、且つピラゾール 4 位のメチル基を選択的にモノハロゲン化することが困難なため収率も芳しくなく、従って4ーチオメチルピラゾール化合物の工業的製法として満足できるものではなかった。

上記方法の原料たる4-クロロメチルピラゾール化合物の製法と

しては、4位無置換のピラゾール化合物を直接クロロメチル化する 方法も知られているが(非特許文献1参照)、この反応は、がん原 性物質であるビス(クロロメチル)エーテルの副生を伴うため、工 業的製法としては問題が多く、採用し難い。

また、ピラゾール化合物を直接チオメチル化する反応は知られていない。

(特許文献1) 国際公開 WO2004/013106号公報 (非特許文献1) ジャーナル オブ ケミカル ソサエティ (Journal of Chemical Society)、1205-1208頁、(1955年)

発明の開示

上記した従来の技術における欠点を解決した、5-ヒドロキシー 4-チオメチルピラゾール化合物を簡便に、且つ収率良く製造する 方法が望まれていた。

上記のような状況に鑑み、本発明者が5ーヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物を製造する方法について鋭意研究を重ねた結果、意外にも、後記一般式(1)で表される5ーヒドロキシピラゾール化合物に、塩基およびホルムアルデヒドの存在下、後記一般式(2)で表される硫黄化合物を反応させることにより、後記一般式(3)で表される5ーヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物が生成することを見出し、この知見に基づき本発明を完成するに至った。

上記構成を有する本発明の方法によれば、後記一般式(1)で表される5-ヒドロキシピラゾール化合物から、特殊な反応装置あるいは高価な触媒もしくは遷移金属を用いることなく、簡便な操作方法且つ穏やかな条件下で、単一工程で収率よく後記一般式(3)で

表される5ーヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物が生成する。しかも、本発明の方法においては、触媒もしくは遷移金属に由来する有害な廃棄物も実質的に生成しないため、環境にも優しく、工業的な利用価値が高い。

加えて、本発明の方法における溶媒として水を用いる態様によれば、更に環境にも優しく、工業的な利用価値が高い方法となる。

(本発明の態様)

本発明は、例えば、下記の〔1〕~〔6〕の態様を包含する。

[1] 一般式(1)

$$R_2$$
 N_N OH (1) R_1

(式中、R₁は水素原子、アルキル基、置換基を有しても良い芳香族炭化水素基、又は置換基を有しても良い複素環基を示し、R₂は電子吸引性基を示す。)

で表されるピラゾール類に、塩基及びホルムアルデヒドの存在下、一般式 (2)

(化 2)
$$X-S(O)_n-R_3$$
 (2)

(式中、Xは水素原子又は金属を示し、R₃はアルキル基、置換基を有しても良い芳香族炭化水素基、又は置換基を有しても良い複素 環基を示し、nはO又は2を示す。)

で表される硫黄化合物を反応させることによる、一般式 (3)

$$R_2$$
 $S(O)_n$ R_3 N_N OH $S(O)_n$ $S(O)$

(式中、R₁、R₂、R₃、nは、前記と同じ意味を示す。) で表される5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物の製

造方法。

[2] nが0である、[1] 項記載の5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法。

- [3] nが2である、[1] 項記載の5-ヒドロキシー4-チオメ チルピラゾール化合物の製造方法。
- [4] R $_2$ で表される電子吸引性基がトリフルオロメチル基である、 [1] ~ [3] の何れか 1 項に記載の 5 -ヒドロキシー 4 -チオメチルピラゾール化合物の製造方法。
- [5] R₂で表される電子吸引性基がシアノ基である、〔1〕~〔3〕の何れか1項に記載の5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法。
- [6] R₂ で表される電子吸引性基がアルコキシカルボキシル基又はカルボキシル基ないしはその金属塩である、[1] ~[3] の何れか1項に記載の5-ヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物の製造方法。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を詳細に説明する。以下の記載において量比を表す「部」および「%」は、特に断らない限り質量基準とする。

(5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法)

本発明は、一般式 (1) で表される 5 ーヒドロキシピラゾール化合物に、塩基及びホルムアルデヒドの存在下、一般式 (2) で表される 硫黄化合物を反応させることを特徴とする、一般式 (3) で表される 5 ーヒドロキシー 4 ーチオメチルピラゾール化合物の製造方法に関するものである。

(異性体)

本発明において原料として用いられる一般式(1)で表される5

ーヒドロキシピラゾール化合物、及び生成物である一般式(3)で表される5ーヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物は、ケトーエノール互変異性体として存在しうる。本明細書においては、原料化合物及び生成物の構造は、一般式(1)または一般式(3)の様にエノール体で代表させて表記することとするが、実際には溶解する溶媒等によりケトーエノール互変異性体の組成比が異なる場合があり、そのような場合においても、ケト体/エノール体何れの異性体も本発明の方法の原料及び生成物に含まれる。

(5-ヒドロキシピラゾール化合物)

まず、本発明において原料として使用する一般式 (1) で表される5-ヒドロキシピラゾール化合物について説明する。

一般式(1)で表される5-ヒドロキシピラゾール化合物を得る 方法は、特に制限されない。すなわち、以下に例示する方法のいず れを用いてもよく、また、他の方法を用いてもよい。

(合成方法の例示)

この5-ヒドロキシピラゾール化合物の合成方法に関しては、例えば、山中宏ら著、"ヘテロ環化合物の化学",第5章(1988年、講談社サイエンティフィク)、J. A. Joule, K. Mills著,"ハンドブック オブ ヘテロサイクリック ケミストリー セカンドエディション(Handbook of Heterocyclic Chemistry 2nd edition)",Chapter 4.3.2.3(2000年,Pergamon)等を参照することができる。

例えば、対応する β -ケトエステル化合物をヒドラジン類と反応させる方法、具体的には4, 4, 4-トリフルオロアセト酢酸エチルとメチルヒドラジンを水溶媒で2時間加熱還流すれば、収率49%で1-メチル-5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾールを合成できることが、ジャーナル オブ ヘテロサイクリック

ケミストリー (Journal of Heterocyclic Chemistry), 第27 巻, 243頁 (1990) に報告されている。

同様に、オキザロ酢酸ジエステル類とヒドラジン類と反応させることで、3-(アルコキシカルボニル)-5-ヒドロキシピラゾール化合物を得る方法、更に得られた化合物のアルコキシカルボニル基をシアノ基に変換する方法について、特開平10-287654 号公報に詳細な説明がある。

また、α-シアノコハク酸類とジアゾニウム塩類との反応で、3-シアノ-5-ヒドロキシピラゾール化合物を得る方法も、特公昭51-33556号に記載されている。

(置換基尺1)

本発明の方法の原料化合物たる5-ヒドロキシピラゾール化合物を示す一般式 (1) においては、一般式 (1) 中のR₁ で表される置換基としては、以下のものを例示することができる。

- (1) 水素原子:
- (2)例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、<math>n-ブチル基、s e c ブチル基、t ブチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基等の、炭素数 1 ~ 6 (以下、炭素数については、例えば炭素数 1 ~ 6 の場合であれば、これを「C 1 $\sim C$ 6 」の様に略記する。)直鎖又は分岐C 1 $\sim C$ 6 アルキル基;
- (3) フェニル基、ナルチル基等の、環を構成する原子数が6~1 4、好ましくは6~10の単環又は縮合環の芳香族炭化水素基。該 芳香族炭化水素基は、下記(3.1)~(3.21)等の置換基を 1以上有しても良い。
- (3.1) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロゲン原子;
- (3.2) 例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプ

ロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルキル基;

- (3.3) ヒドロキシル基;
- (3.4) 例えば、メトキシ基、エトキシ基、 n プロポキシ基、 イソプロポキシ基等の、直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 アルコキシ基;
- (3.5) 例えば、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基 等の、直鎖又は分岐C1~C6ヒドロキシアルキル基;
- (3.6) 例えば、メトキシメチル基、1-メトキシエチル基、1-エトキシエチル基等の、直鎖又は分岐($C1\sim C6$ アルコキシ)- ($C1\sim C6$ アルキル)基;
- (3.7)例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は分岐C1~C6ハロアルキル基;
- (3.8) カルボキシル基
- (3.9)又は、そのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等のアルカリ金属塩やカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;
- (3.10) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル 基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ) カルボニル基;
- (3.11) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の、環を構成する原子数が6~14、好ましくは6~10のアリールカルボニル基:
- (3.12)例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基 、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選 ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成 する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘ テロアリールカルボニル基;

- (3.13) ニトロ基;
- (3.14) アミノ基;
- (3.15) 例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の、直鎖又は分岐のモノ又はジ(C1~C6アルキル) アミノ基;
- (3.16)例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、 ブチリルアミノ基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カル ボニルアミノ基;
- (3.17) 例えば、ヒドロキシカルボニルメチル基、1-ヒドロキシカルボニルエチル基等の、直鎖又は分岐ヒドロキシカルボニル (C1~C6アルキル)基;
- (3.18) 例えば、メトキシカルボニルメチル基、1-メトキシカルボニルエチル基、1-エトキシカルボニルエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)カルボニル-(C1~C6アルキル)基;
- (3.19) 例えば、アミノカルボニルメチル基、1-アミノカルボニルエチル基等の、直鎖又は分岐アミノカルボニルー (C1~C6アルキル) 基;
- (3.20) 例えば、メチルアミノカルボニルメチル基、1-メチルアミノカルボニルエチル基、1-エチルアミノカルボニルエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)アミノカルボニルー(C1~C6アルキル)基;
 - (3.21)シアノ基等。
- (4) 例えばフリル基、ベンゾフリル基、ピリジル基、チエニル基 、ベンゾチエニル基、オキザゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、チ アゾリル基、ベンゾチアゾリル基、イソオキサゾリル基、チアジア ゾリル基、ピラジル基、ピリミジニル基、インドリル基、キノリニ

ル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、トリアゾリル基、トリアジニル基等に代表される、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環の芳香族複素環基。該芳香族複素環基は、下記(4.1)~(4.19)等の置換基を1以上有しても良い。

(4.1) 例えば、メチル基、エチル基、 n ープロピル基、イソプロピル基、 n ーブチル基、 s e c ーブチル基、 t ーブチル基、 n ーペンチル基、 n ーヘキシル基等の、直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 アルキル基;

(4.2) ヒドロキシル基;

(4.3) 例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、 イソプロポキシ基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルコキシ基;

(4.4) 例えば、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等の 、直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 ヒドロキシアルキル基;

(4.5) 例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)-(C1~C6アルキル)基;

(4.6) 例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は分岐 C1~C6 ハロアルキル基;(4.7) カルボキシル基、

(4.8)又はそのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等のアルカリ金属塩やカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;

(4.9) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基 等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)カルボニル基;

(4.10) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロ

ゲン原子;

- (4.11) 二トロ基;
- (4.12) アミノ基;
- (4.13) 例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の、直鎖又は分岐のモノ又はジ(C1~C6アルキル) アミノ基;
- (4.14) 例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ブチリルアミノ基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニルアミノ基;
- (4.15)シアノ基;
- (4.16) ホルミル基;
- (4.17) 例えば、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニル基;
- (4.18) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の、環を構成する原子数が6~14、好ましくは6~10のアリールカルボニル基・
- (4.19) 例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘテロアリールカルボニル基等の置換基。
- (5) 例えばヒドロフリル基、ピラニル基、チオラニル基、チアニル基、ピロリジニル基、インドリニル基、ピペリジニル基、イミダゾリジニル基、ピペラジニル基等に代表される、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環の芳香族性を有しない複素環基。該芳香族性を有し

ない複素環基は、下記(5.1)~(5.19)等の置換基を1以 上有しても良い。

- (5.1) 例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルキル基;
- (5.2) ヒドロキシル基;
- (5.3) 例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、 イソプロポキシ基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルコキシ基:
- (5.4) 例えば、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等の 、直鎖又は分岐C1~C6ヒドロキシアルキル基;
- (5.5) 例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)-(C1~C6アルキル)基;
- (5.6) 例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は分岐C1~C6ハロアルキル基;(5.7) カルボキシル基、
- (5.8)又はそのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等のアルカリ金属塩やカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;
- (5.9) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基 等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)カルボニル基:
- (5.10) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロゲン原子;
- (5.11) ニトロ基;
- (5.12) アミノ基;
- (5.13) 例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチル

アミノ基、ジエチルアミノ基等の、直鎖又は分岐のモノ又はジ(C 1~C6アルキル)アミノ基;

(5.14) 例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ブチリルアミノ基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニルアミノ基;

- (5.15)シアノ基;
- (5.16) ホルミル基;
- (5.17) 例えば、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニル基;
- (5.18) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の、環を構成する原子数が6~14、好ましくは6~10のアリールカルボニル基;
- (5.19) 例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘテロアリールカルボニル基等の置換基を1以上有していても良い。

(好ましい置換基R,)

上記した中でも、入手容易性の点からは、置換基R₁としては、 以下のものが好適に使用可能である。

メチルに代表されるC1~C6アルキル基;フェニルに代表される、環を構成する原子数が6~14の芳香族炭化水素基が好ましく、特にメチル基、フェニル基が好ましい。

(電子吸引性基R。)

一般式(1)中のR2で表される電子吸引性基とは、誘起効果により相手から電子を引きつける原子団およびそれら原子団を有する 芳香族炭化水素基或いはそれら原子団を有する芳香族複素環基を意

味する。この電子吸引性基 R_2 としては、具体的には、以下のものを例示することができる。

- (1)ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は 分岐C1~C6ハロアルキル基;カルボキシル基、又はそのナトリ ウム塩、カリウム塩、リチウム塩等のアルカリ金属塩やカルシウム 塩、バリウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;
 - (2) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の 、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)カルボニル基;
 - (3) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロゲン原子;ニトロ基;ホルミル基;
 - (4) 例えば、メチルカルボニル基(アセチル基)、エチルカルボ ニル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニル基;
 - (5) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の環を構成する原子数 が6~14、好ましくは6~10のアリールカルボニル基;
 - (6) 例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘテロアリールカルボニル基;
 - (7) 例えば、アミノカルボニル基、メチルアミノカルボニル基、 ジメチルアミノカルボニル基等の、直鎖又は分岐モノ又はジ(C1 ~C6アルキル)アミノカルボニル基;シアノ基;
 - (8) 例えば、クロロフェニル基(例えば 2, 4 ジクロロフェニル基)、カルボキシフェニル基、ニトロフェニル基等の、前記の、誘起効果により相手から電子を引きつける原子団を置換基として 1 以上有する、環を構成する原子数が 6 ~ 1 4、好ましくは 6 ~ 1 0

の芳香族炭化水素基;

(9)例えばクロロフリル基、クロロベンゾフリル基、クロロピリジル基、クロロチエニル基、カルボキシルベンゾチエニル基、ニトロオキザゾリル基、シアノベンゾオキサゾリル基、クロロチアゾリル基、クロロベンゾチアゾリル基、アセチルイソオキサゾリル基、クロロベンゾチアゾリル基、クロロピラジル基、クロロピラジル基、クロロピラジル基、クロロピラジル基、アミノカルボニルピラゾリル基、メチルアミノカルボニルイミダゾリル基、メトキシカルボニルトリアゾリル基、クロロトリアジニル基等に代表される、前記の、誘起効果により相手から電子を引きつける原子団を置換基として1、以上有する、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環の芳香族複素環基、等を例示することができる。

(好ましい電子吸引性基R。)

上記した中でも、塩基存在下という反応条件下での安定性、及び それに伴う収率の安定性の点からは、電子吸引性基R₂としては、 以下のものが好適に使用可能である。

トリフルオロメチルに代表されるC1~C6ハロアルキル基;2 ,4一ジクロロフェニルに代表される、誘起効果により相手から電子を引き付ける原子団を置換基として1以上有する、環を構成する原子数が6~14の芳香族炭化水素基;シアノ基が好ましく、特にトリフルオロメチル基、2,4一ジクロロフェニル基、シアノ基が好ましい。

(好ましい5-ヒドロキシピラゾール化合物)

従って、一般式(1)で表される5-ヒドロキシピラゾール化合

物としては、具体的に、例えば、5-ヒドロキシー3-トリフルオ ロメチルピラゾール、3-エトキシカルボニル-5-ヒドロキシピ ラゾール、3-アセチル-5-ヒドロキシピラゾール、3-ベンゾ イルー5-ヒドロキシピラゾール、5-ヒドロキシー3-(3-ピ リジルカルボニル) ピラゾール、3-シアノ-5-ヒドロキシピラ ゾール、5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピ ラゾール、3-エトキシカルボニル-5-ヒドロキシ-1-メチル ピラゾール、3-クロロー5-ヒドロキシー1-メチルピラゾール 、5-ヒドロキシ-1-メチル-3-ニトロピラゾール、5-ヒド ロキシ-1-メチル-3-(2-チエニルカルボニル) ピラゾール 、5-ヒドロキシ-1-メチル-3-(3-ピリジルカルボニル) ピラゾール、3-ジメチルアミノカルボニル-5-ヒドロキシ-1 - メチルピラゾール、5 - ヒドロキシ-1 - メチル-3 - (4 - ト リフルオロメチルフェニル)ピラゾール、3-(4-エトキシカル ボニルフェニル) -5-ヒドロキシ-1-メチルピラゾール、3-(2, 4-ジクロロフェニル) -5-ヒドロキシ-1-メチルピラ ゾール、3-(3,5-ジニトロフェニル)-5-ヒドロキシ-1 -メチルピラゾール、3-(4-ジメチルアミノカルボニル)-5 -ヒドロキシ-1-メチルフェニルピラゾール、5-ヒドロキシー 1-n-プロピル-3-トリフルオロメチルピラゾール、3-シア ノー1-n-ヘキシル-5-ヒドロキシピラゾール、1-t-ブチ ル-5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾール、1-t -ブチル-3-(4-カルボキシフェニル)-5-ヒドロキシピラ ゾール、3-(4-アセチルフェニル)-1-t-ブチル-5-ヒ ドロキシピラゾール、1-t-ブチル-3-(4-シアノフェニル) - 5 - ヒドロキシピラゾール、5 - ヒドロキシー1 - フェニルー 3-トリフルオロメチルピラゾール、3-シアノ-5-ヒドロキシ

-1-フェニルピラゾール、1-(4-クロロフェニル)-3-エ トキシカルボニルー5-ヒドロキシピラゾール、3-エトキシカル ボニル-5-ヒドロキシ-1-(2-メチルフェニル) ピラゾール 、3-エトキシカルボニル-5-ヒドロキシ-1-(2-メトキシ メチルフェニル) ピラゾール、1-(4-アセチルフェニル)-3 -エトキシカルボニル-5-ヒドロキシピラゾール、3-エトキシ カルボニル-5-ヒドロキシ-1-(3-ニトロフェニル)ピラゾ ール、5-ヒドロキシ-1-(2-メトキシフェニル)-3-トリ フルオロメチルピラゾール、5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメ チルー1ー(4ートリフルオロメチルフェニル)ピラゾール、1-(4-エトキシカルボニルフェニル)-5-ヒドロキシ-3-トリ フルオロメチルピラゾール、1-(4-ジメチルアミノフェニル) -5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾール、1-(4 ーアセチルアミノフェニル) -5-ヒドロキシ-3-トリフルオロ メチルピラゾール、1-(4-メトキシカルボニルメチルフェニル) -5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾール、1-(4-ジメチルアミノカルボニルメチルフェニル)-5-ヒドロキシ -3-トリフルオロメチルピラゾール、1-(4-シアノフェニル) -5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾール、1-(2-ナフチル)-5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾ ール、1-(2-ベンゾチアゾリル)-5-ヒドロキシ-3-トリ フルオロメチルピラゾール、5-ヒドロキシ-1-(2-ピリジル) - 3 - トリフルオロメチルピラゾール、5 - ヒドロキシ-1 - (2-ピリミジル)-3-トリフルオロメチルピラゾール等が挙げら れる。

(硫黄化合物)

続いて、一般式(2)で表される硫黄化合物について説明する。

一般式 (2) 中の R₃ で表される置換基としては、以下のものを 例示することができる。

- (1) 例えば、メチル基、エチル基、 n ープロピル基、イソプロピル基、 n ーブチル基、 s e c ーブチル基、 t ーブチル基、 n ーペンチル基、 n ーペンチル基、 n ーペキシル基等の、直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 アルキル基;フェニル基、ナフチル基等の、環を構成する原子数が 6 ~ 1 4、好ましくは 6 ~ 1 0 の単環又は縮合環の芳香族炭化水素基(該芳香族炭化水素基は、例えば、メチル基、エチル基、 n ープロピル基、イソプロピル基、 n ーブチル基、 s e c ーブチル基、 t ーブチル基、 n ーペンチル基、 n ーペンチル基、 n ーペキシル基等の、直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 アルキル基;
 - (2) ヒドロキシル基;
- (3) 例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソ プロポキシ基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルコキシ基;
- (4) 例えば、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等の、直鎖又は分岐C1~C6ヒドロキシアルキル基;
- (5) 例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)-(C1~C6アルキル)基;
- (6) 例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は分岐C1~C6ハロアルキル基;カルボキシル基、又はそのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等のアルカリ金属塩やカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;
- (7) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の 、直鎖又は分岐 (C1~C6アルコキシ) カルボニル基;
- (8) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロゲン原

子; ニトロ基; アミノ基;

(9) 例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ 基、ジエチルアミノ基等の、直鎖又は分岐のモノ又はジ(C1~C 6アルキル)アミノ基;

(10) 例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ブチリルアミノ基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルキルカルボニルアミノ基; シアノ基; ホルミル基;

(11)例えば、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基等の、 直鎖又は分岐 (C1~C6アルキル)カルボニル基;

(12) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の、環を構成する原子数が6~14、好ましくは6~10のアリールカルボニル基;

(13) 例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘテロアリールカルボニル基等の置換基を1以上有していても良い。);(14) 例えばフリル基、ベンゾフリル基、ピリジル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、オキザゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、チエニルをアゾリル基、ベンゾチアゾリル基、インドリル基、キノリニル基、ピラブリル基、イミダブリル基、ベンゾイミダブリル基、トリアブリル基、トリアジニル基等に代表される、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環の芳香族複素環基(該芳香族複素環基は、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、

チル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-

ヘキシル基等の、直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 アルキル基;

- (15) ヒドロキシル基;
- (16)例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルコキシ基;
- (17) 例えば、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等の、 直鎖又は分岐 C 1 ~ C 6 ヒドロキシアルキル基;
- (18) 例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)-(C1~C6アルキル)基;
- (19) 例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は分岐C1~C6ハロアルキル基;
- (20) カルボキシル基、又はそのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等のアルカリ金属塩やカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩等のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;
- (21) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)カルボニル基;
- (22) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロゲン原子; ニトロ基; アミノ基;
- (23) 例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の、直鎖又は分岐のモノ又はジ(C1~C6アルキル)アミノ基;
- (24) 例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ブチリルアミノ基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニルアミノ基;シアノ基;ホルミル基;
- (25)例えば、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基等の、 直鎖又は分岐 (C1~C6アルキル)カルボニル基;

(26) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の、環を構成する原子数が6~14、好ましくは6~10のアリールカルボニル基;

(27) 例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘテロアリールカルボニル基等の置換基を1以上有していても良い。) や、例えばヒドロフリル基、ピラニル基、チオラニル基、チアニル基、ピロリジニル基、インドリニル基、ピペリジニル基、イミダゾリジニル基、ピペラジニル基等に代表される、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個行する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環の芳香族性を有しない複素環基(該複素環基は、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルキル基;ヒドロキシル基;

- (28) 例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基等の、直鎖又は分岐C1~C6アルコキシ基;
- (29) 例えば、ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基等の、 直鎖又は分岐C1~C6ヒドロキシアルキル基;
- () 例えば、メトキシメチル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ)-(C1~C6アルキル)基;
- (30) 例えば、フルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基等の、直鎖又は分岐C1~C6ハロアルキル基;カルボキシル基、又はそのナトリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等

のアルカリ金属塩やカルシウム塩、バリウム塩、マグネシウム塩等 のアルカリ土類金属塩に代表される、カルボキシル基の金属塩;

- (31) 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルコキシ) カルボニル基;
- (32) 例えば、ブロモ、クロロ、フルオロ、ヨード等のハロゲン原子;ニトロ基;アミノ基;
- (33) 例えば、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基等の、直鎖又は分岐のモノ又はジ(C1~C6アルキル)アミノ基;
- (34) 例えば、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、ブチリルアミノ基等の、直鎖又は分岐(C1~C6アルキル)カルボニルアミノ基;シアノ基;ホルミル基;
- (35) 例えば、メチルカルボニル基、エチルカルボニル基等の、 直鎖又は分岐 (C1~C6アルキル) カルボニル基;
- (36) 例えばベンゾイル基、ナフトイル基等の、環を構成する原子数が $6\sim14$ 、好ましくは $6\sim10$ のアリールカルボニル基;
- (37) 例えばピリジルカルボニル基、チエニルカルボニル基、フリルカルボニル基等の、窒素原子、酸素原子、硫黄原子から選ばれる少なくとも1つを異項原子として1~4個有する、環を構成する原子数が5~14、好ましくは5~10の単環又は縮合環のヘテロアリールカルボニル基等の置換基を1以上有していても良い。)を包含する芳香族性を有するか又は有しない複素環基等。

(基X)

そして、一般式(2)中のXは、例えば、水素原子;例えば、ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属、又はマグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属等に代表される金属原子を示す。

一般式(2)中のnが0の場合はチオール類又はその塩を示すのであり、nが2の場合はスルフィン酸類又はその塩を示すものである。

当反応に使用する際の硫黄化合物は、一般式(2)中のXが水素原子でも、ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属およびマグネシウム、カルシウム等のアルカリ土類金属等の金属塩でも良く、更に、硫黄化合物がチオール類(即ち、一般式(2)中のnが0の化合物)の場合には、該当するハロゲン化アルキルとチオウレアとの反応により容易に調製される、イソチウロニウム塩等に代表されるチオール類を生成する前駆体を、同一反応容器中で加水分解することにより当反応の原料とすべきチオール類を系内で形成して用いてもよい。

(硫黄化合物の具体例)

従って、一般式 (2) で表される硫黄化合物としては、具体的に、例えば、ナトリウムチオメトキシド、ナトリウムチオエトキシド、2ーブタンチオール、チオフェノール、2ーエチルチオフェノール、4ーメトキシチオフェノール、4ークロロチオフェノール、4ーニトロチオフェノール、4ージメチルアミノチオフェノール、4ーシアノチオフェノール、4ーアセチルチオフェノール、2ーメルカプトピリジン、2ーメルカプトベンソオキサゾール、2ーメルカプトベンゾチアゾールや、nーヘキシルチオカルボキサミジン塩酸塩、[5,5ージメチル(4,5ージヒドロイソオキサゾロー3ーイル)] チオカルボキサミジン塩酸塩等に代表されるイソチウロニウム塩、ベンゼンスルフィン酸ナトリウム、pートルエンスルフィン酸ナトリウム等が挙げられる。

(反応方法)

次に、一般式(1)で表される5-ヒドロキシピラゾール化合物と一般式(2)で表される硫黄化合物を反応させて、一般式(3)で表される5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物を製造する方法について説明する。

(ホルムアルデヒド)

上記反応は、ホルムアルデヒドの存在下に行われる。当反応に用いるホルムアルデヒドは、特に形態を問うものではなく何れの形態でもかまわないが、市販品として入手容易な35%ホルマリンに代表される、35~50%のホルムアルデヒドの水溶液や、パラホルムアルデヒド(ホルムアルデヒドの重合体であって、加水分解することにより系内でホルムアルデヒドを生成するため、ホルムアルデヒドの等価体として使用できる。)の使用が、操作的にも簡便であり好ましい。

(使用量)

ホルムアルデヒドの使用量としては、一般式(1)で表される原料化合物 1 当量に対し当量以上であれば良いが、一般式(1)で表される原料化合物 1 モルに対して通常 1 . $0 \sim 5$. 0 当量、好ましくは 1 . $0 \sim 3$. 0 当量の範囲であれば良い。

一般式(2)で表される硫黄化合物は、(1)の原料化合物の当量以上であれば良いが、一般式(1)で表される原料化合物1モルに対して通常1.0~2.0当量、好ましくは1.0~1.2当量の範囲であれば良い。

(塩基)

本発明における反応は、塩基の存在下に行われる。当反応に用いる塩基としては、以下のものを例示することができる。

(1) 例えば、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化リチウム等の水素化アルカリ金属;

(2) 例えば金属ナトリウム、金属カリウム、金属リチウム等のアルカリ金属;

- (3) 例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム 等のアルカリ金属水酸化物;
- (4) 例えば水酸化バリウム、水酸化マグネシウム、水酸化カルシウム等のアルカリ土類金属水酸化物;
- (5) 例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム 、炭酸水素カリウム等のアルカリ金属炭酸塩;
- (6) 例えば酸化バリウム、酸化マグネシウム及び酸化カルシウム等のアルカリ土類金属酸化物等に代表される無機塩基;ならびに、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、 t ブトキシカリウム等の金属アルコキシド;
- (7) 例えばブチルリチウム等のアルキル金属等に代表される有機 塩基。

上記した中でも入手性の点などから、好ましくはアルカリ金属水酸化物又は金属アルコキシドであり、反応を水溶媒で行いうることにより排水後処理等の負荷の軽減が図れる点からはアルカリ金属水酸化物、中でも水酸化ナトリウムが特に好ましい。

(塩基の使用量)

塩基の使用量は、反応が充分に進行する量であれば何れでもよいが、一般式(1)で表される5-ヒドロキシピラゾール化合物(原料化合物)1モルに対して1.0~20モル、好ましくは1.5~10モル、より好ましくは1.5~3.0モルの範囲を例示できる

(溶媒)

本発明の反応は、必要に応じて、溶媒の存在下で行っても良い。

当反応に用いうる溶媒としては、反応を阻害しないものであれば良く、例えば、水;メタノール、エタノール等のアルコール類;トルエン、キシレン、クロロベンゼン等の芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン化脂肪族炭化水素類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン、テトラメチル尿素、ヘキサメチルホスホリックトリアミド(HMPA)、プロピレンカーボネート等の非プロトン性極性溶媒類;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒類;ペンタン、nーヘキサン等の脂肪族炭化水素類等が挙げられる。この溶媒は単独で、又は任意の混合割合の混合溶媒として用いることができる。塩基の溶解性、反応性の観点から、好ましくは水又はアルコール類を用いるのがよく、特に、水又はメタノール中で行うのが好ましい。

溶媒量としては、反応系の攪拌が充分にできる量であれば良いが、一般式(1)で表される5-ヒドロキシピラゾール化合物(原料化合物)1モルに対して通常0.05~10L(リットル)、好ましくは0.5~2Lの範囲であれば良い。

(反応条件)

当反応の反応温度は、0 \mathbb{C} \sim 使用する溶媒の還流温度、の範囲を例示できるが、好ましくは2 0 \mathbb{C} \sim 5 0 \mathbb{C} で反応させ、特に室温で攪拌するのが簡単で収率も良い。

当反応の反応時間は特に制限されないが、通常は1時間~10時間で反応は充分に完結する。

当反応によれば、簡便な操作方法且つ穏やかな条件下で、収率よく一般式(3)で表される5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物を製造することができる。得られる一般式(3)で表される5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物は、医農薬

等の中間原料として有用な化合物である。

(実施例)

次に、実施例を挙げて本発明化合物の製造方法を具体的に説明するが、本発明は、これら実施例によって何ら限定されるものではない。

(参考例1):5-ヒドロキシー1-メチルー3-トリフルオロメ チルピラゾールの合成

4, 4, 4-トリフルオロアセト酢酸エチル92.1g(0.5 mol)を酢酸60.1g(1.0 mol)に溶解させた。攪拌下、溶液を10℃以下に冷却した後、35%メチルヒドラジン水溶液65.8g(0.5 mol)を1時間かけて滴下した。滴下後、室温で1時間、引き続き、80℃で5時間攪拌した。反応後、室温に冷却し、トルエン150mL(ミリリットル)、水600mL及び水酸化ナトリウム48g(1.2 mol)を加えた。分液後、得られる水層に35%塩酸154g(1.5 mol)を滴下し、生成する結晶を濾取した。結晶を水50mLで2回洗浄し、温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物71.8g(収率;86.5%)を淡黄色結晶として得た。

L C - M S (E I) : m / z = 1 6 6 (M⁺)、融点: 1 7 9 - 1 8 0 ℃

(参考例2):5-ヒドロキシー1-フェニルー3-トリフルオロメチルピラゾールの合成

4, 4, 4-トリフルオロアセト酢酸エチル18.4g(0.1 mol)を酢酸12.0g(0.2mol)に溶解させた。攪拌下

、溶液を10℃以下に冷却した後、フェニルヒドラジン11.8g(0.11mol)を0.5時間かけて滴下した。滴下後、室温で1時間、引き続き、80℃で5時間攪拌した。反応後、室温に冷却し、水100mLを加えた。生成する結晶を濾取し、水50mLで2回洗浄し、温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物22.3g(収率;98.0%)を淡黄色結晶として得た。

LC-MS (EI): m/z = 228 (M⁺)、融点:190-192°C

(参考例3):5-ヒドロキシー3-トリフルオロメチルピラゾー ル塩酸塩の合成

4, 4, 4-トリフルオロアセト酢酸エチル18.4g(0.1 mol)をエタノール20mLに溶解させた。攪拌下、溶液を10℃以下に冷却した後、ヒドラジン6.0g(0.12mol)を0.5時間かけて滴下した。滴下後、室温で1時間、引き続き、還流温度で5時間攪拌した。反応後、室温に冷却し、水100mL及び35%塩酸20.6g(0.2mol)を加えた。生成する結晶を濾取し、水10mLで2回洗浄し、温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物12.8g(収率;68.1%)を白色結晶として得た。

 $LC - MS (EI) : m / z = 152 (M^{+})$

(参考例 4):3-エトキシカルボニル-5-ヒドロキシ-1-メ チルピラゾールの合成

オキザロ酢酸ジエチルモノナトリウム50.0g(0.24mol)をエタノール500mLに懸濁させ、酢酸25mLを加えた。 攪拌下、97%メチルヒドラジン15g(0.33mol)を室温

で 0 . 5 時間かけて滴下した。滴下後、室温で 2 時間、引き続き、還流温度で 5 時間攪拌した。冷却後、エタノールを減圧留去し、酢酸エチル 2 0 0 m L、水 1 0 0 m Lを加えた。分液後、水層を酢酸エチル 5 0 m Lで再抽出し、合わせた酢酸エチル層を水 5 0 m L、飽和食塩水 5 0 m Lで順次洗浄した。得られた酢酸エチル層を、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。析出した結晶に、水 1 0 0 m Lを加え、結晶を濾取し、水 1 0 m Lで洗浄し、温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物 2 9 . 2 g(収率;71.8%)を淡黄色結晶として得た。

L C - M S (E I): m/z=170 (M⁺), 125 (base)、融点:151 $^{\circ}$ C

(参考例5):3-シアノ-5-ヒドロキシ-1-フェニルピラゾ ールの合成

アニリン5.6g(0.06m。1)に水120mL、35%塩酸15mLを加え、溶解させた。0~5℃に氷冷攪拌下、亜硝酸ナトリウム4.2g(0.06m。1)を溶解させた水24mLを滴下し、1時間攪拌し、塩化ベンゼンジアゾニウム塩を調製した。次いで、このジアゾニウム塩の水溶液をαーシアノコハク酸ジエチル10.2g(0.06m。1)のピリジン120mL溶液に、氷冷攪拌下、滴下した。滴下後、氷冷下で1時間、引き続き、室温で1時間攪拌した。反応後、2%水酸化ナトリウム水溶液240mLを加え、2時間攪拌した。次いで、反応液を氷冷下、35%塩酸240mLに滴下した。析出した結晶を濾取し、水10mLで洗浄し、温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物の粗結晶8.4gを赤褐色結晶として得た。これを、ジエチルエーテルー石油エーテルから再結晶し、温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物

5.7g(収率;51.3%)を淡黄色結晶として得た。
 LC-MS(EI):m/z=185(M⁺),125(base)、融点:190℃

(参考例6):3-(2,4-ジクロロフェニル)-5-ヒドロキシ-1-メチルピラゾールの合成

マロン酸エチルカリウム塩22.1g(0.13mol)を酢酸 エチル200mLに懸濁し、氷冷攪拌下、トリエチルアミン29. 14g(0.29mol)、塩化マグネシウム13.7g(0.1 4 m o l) を順次加えた。この懸濁液を、40℃で6時間攪拌した 後、再び氷冷し、反応液が10℃以下を保つよう、2,4-ジクロ ロベンゾイルクロライド20.9g(0.1mol)を1時間かけ て滴下した。滴下後、室温で12時間攪拌を続けた。反応液に5% 塩酸200mLを滴下し、有機層を分取した。得られた有機層を、 水50mLで2回、飽和食塩水30mLで順次洗浄した後、減圧下 溶媒を留去した。濃縮により得られた残渣に、エタノール100m Lを加えた。攪拌下、溶液を10℃以下に冷却した後、35%メチ ルヒドラジン水溶液13.1g(0.1mol)を1時間かけて滴 下した。滴下後、室温で1時間、引き続き、80℃で3時間攪拌し た。反応後、室温に冷却し、水300mLを加え、生成する結晶を 濾取した。結晶を水50mLで2回洗浄し、温風乾燥機にて乾燥す ることにより、表題化合物 1 2. 3 g (収率; 5 0. 2%) を白色 結晶として得た。

¹ H-NMR値(300MHz, CDCl₃): σ =7.53(d; J=1.8Hz, 1H), 7.2-7.4(m, 2H), 5.6 8(s, 1H), 3.54(s, 3H)ppmLC-MS(EI):m/z=242〔(M-1)⁺〕、融点:221-223℃

(参考例7):3-(3,5-ジニトロフェニル)-5-ヒドロキシ-1-メチルピラゾールの合成

マロン酸エチルカリウム塩11.0g(0.07mol)を酢酸 エチル100mLに懸濁し、氷冷攪拌下、トリエチルアミン14. 5 g (0.19 m o 1)、塩化マグネシウム 6.9 g (0.08 m o 1) を順次加えた。この懸濁液を、40℃で6時間攪拌した後、 再び氷冷し、反応液が10℃以下を保つよう、3、5ージニトロベ ンゾイルクロライド11.5g(0.05m01)を1時間かけて 滴下した。滴下後、室温で12時間攪拌を続けた。反応液に5%塩 酸100mLを滴下し、有機層を分取した。得られた有機層を、水 50mLで2回、飽和食塩水30mLで順次洗浄した後、減圧下溶 媒を留去した。濃縮により得られた残渣に、エタノール100mL を加えた。攪拌下、97%メチルヒドラジン2.4g(0.05m o 1) を室温で滴下した。滴下後、室温で1時間、引き続き、80 ℃で3時間攪拌した。反応後、室温に冷却し、水300mLを加え 、生成する結晶を濾取し、結晶を水50mLで2回洗浄した。得ら れた結晶を50%エタノール水から再結晶し、温風乾燥機にて乾燥 することにより、表題化合物4.2g(収率;30.2%)を赤色 結晶として得た。

¹ H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ = 8.90 (t; J=2.1Hz, 1H), 8.85 (d; J=2.1Hz, 2H), 4.60 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.3-3.4 (m, 1H) ppm、LC-MS (EI):m/z=264 (M⁺)、融点:230-231℃

(参考例8):3-クロロー5,5-ジメチルー4,5-ジヒドロイソオキサゾールの合成

エタノール500mL、炭酸水素ナトリウム63.0g(0.75mol)を加え、室温で撹拌させた。イソブテンガス84.2g(1.50mol)を吹き込みながら0.5時間後、70℃に昇温し、ジクロロホルムオキシムの40%イソプロピルエーテル溶液131.3g(0.5mol)を反応液に徐々に滴下し、同温で8時間攪拌した。25℃以下まで放冷し、ろ過により無機固体を除去した後、62℃/1.1kPaで減圧蒸留を行い、無色透明液体の3-クロロー4,5-ジヒドロイソキサゾール32.3g(収率51%)を無色透明液体として得た。

 1 H − NMR値(300MH z, MeOH − d 4): σ = 2.88 (s, 2H), 1.41 (s, 3H) ppm、LC−MS (EI) : m/z = 133 (M⁺), 118 (base)、沸点:50℃/0.7kPa、

(参考例9): [5,5-ジメチル(4,5-ジヒドロイソオキサ ゾロ-3-イル)] チオカルボキサミジン塩酸塩の合成

チオ尿素16.8g(0.2mol)のエタノール100mL(0.5 1 / mol)溶液に、35%塩酸4.1 7g(0.0 4mo 1)を加え、室温で撹拌しながら3-クロロー5,5-ジメチルー 4,5-ジヒドロイソオキサゾール26.7g(0.2mol)を 1時間かけて滴下し、引き続き、30℃で3時間撹拌した。続いて 、反応液にトルエン100mLを加え、減圧下、溶媒を留去すると 、58.3gの白色結晶が析出した。得られた粗結晶にイソプロピ ルアルコール300mLを加え結晶が溶解するまで加熱後、徐々に 冷却して、表題化合物38.5g(収率;92.0%)を白色結晶と して得た。

 1 H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ = 4.84

(s, 3H), 3.08(s, 2H), 1.46(s, 3H) pp m、融点:147℃、

実施例1:5-ヒドロキシ-1-メチル-4-メチルチオメチル-3-トリフルオロメチルピラゾールの合成

参考例1で合成した5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾール1.7g(10mmol)と水酸化ナトリウム0.6g(15mmol)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、10%ナトリウムチオメトキシド水溶液7.1g(10mmol)を室温で滴下し、6時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。析出した結晶を濾取した後、水5mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物1.6g(収率72.7%)を淡黄色結晶として得た。得られた結晶を、水ーメタノールから再結晶し、白色結晶として得た。

¹ H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ = 4.86 (br, 1H), 3.64 (s, 3H), 3.56 (s, 2H), 2.02 (s, 3H) ppm、LC-MS (EI):m/z=22 6 (M⁺), 179 (base)、融点:123-124℃

実施例2: [(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメ チルピラゾロ-4-イル)-メチルチオ]ベンゼンの合成

参考例1で合成した5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾール1.7g(10mmol)と水酸化ナトリウム0.6g(15mmol)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmo

1)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、チオフェノール11.0g(10mmol)を室温で滴下し、7時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。析出した結晶を濾取した後、水5mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物2.2g(収率76.4%)を淡黄色結晶として得た。得られた結晶を、n-ヘキサン-2-プロパノールから再結晶し、白色結晶として得た。

 1 H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ =7.1-7.3 (m, 5H), 4.86 (br, 1H), 3.99 (s, 2H), 3.61 (s, 3H)、LC-MS (EI):m/z=288 (M⁺), 110 (base)、融点:152℃

実施例3:3-[(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルチオ]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチルイソオキサゾールの合成

参考例1で合成した5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾール1.7g(10mmol)と水酸化ナトリウム1.6g(40mmol)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、[5,5ージメチル(4,5ージヒドロイソオキサゾロー3ーイル)]チオカルボキサミジン塩酸塩2.1g(10mmol)の水10mL溶液を室温で滴下し、同温度で2時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。析出した結晶を濾取した後、水5mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物2.5g(収率80.1%)を淡黄色結晶として得た。得られた結晶を、nーへキサンー2ープロパノールから再結晶し、白色結晶とし

て得た。

¹ H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ = 4.88 (br, 1H), 4.08 (s, 2H), 3.64 (s, 3H), 2.91 (s, 2H), 1.39 (s, 6H) ppm、LC-MS (EI):m/z=309 (M⁺), 177 (base)、融点: 115-116℃

実施例4:3-[(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルチオ]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチルイソオキサゾールの合成

参考例1で合成した5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾール1.7g(10mmol)と28%ナトリウムメトキシドのメタノール溶液6.0g(30mmol)をメタノール10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、パラホルムアルデヒド1.7gを投入し、同温で1時間攪拌した。これに、[5,5ージメチル(4,5ージヒドロイソオキサゾロー3ーイル)]チオカルボキサミジン塩酸塩2.1g(10mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。更に水10mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水5mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物2.6g(収率84.1%)を淡黄色結晶として得た。1H-NMRスペクトルは実施例3と一致した。

実施例5:3-[(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルチオ]-4,5-ジヒドロー5,5-ジメチルイソキサゾールの合成実施例4記載の反応において、塩基を炭酸カリウム4.2g(30mmo1)に変更した以

外は実施例4と同様の操作により、表題化合物2.3g(収率74.2%)を淡黄色結晶として得た。 ¹ H-NMRスペクトルは実施例3と一致した。

実施例 6 (電子吸引基がトリフルオロメチル基の態様):4-[(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾロー4-イル)-メチルスルフォニル]トルエンの合成

参考例1で合成した5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾール8.3g(50mmol)と水酸化ナトリウム3.0g(75mmol)を水50mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液8.5g(100mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム9.0g(50mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸25.0g(250mmol)を滴下した。更に水100mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水20mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物14.0g(収率83.8%)を白色結晶として得た

 1 H − NMR値(300MHz, MeOH−d4): σ = 7.62 (d; J = 8.4Hz, 2H), 7.39 (d; J = 8.4Hz, 2H), 4.85 (br, 1H), 4.32 (s, 2H), 3.6 3 (s, 3H), 2.44 (s, 3H) ppm、LC−MS (EI) : m/z = 334 (M⁺), 179 (base)、融点:135 ℃

実施例7:4-[(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルスルフォニル]トルエンの

合成

参考例1で合成した5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾール1.7g(10mmol)と水酸化ナトリウム0.6g(15mmol)をDMF10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、パラホルムアルデヒド1.7gを投入し、同温で1時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム1.8g(10mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。更に水10mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水5mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物3.0g(収率88.2%)を白色結晶として得た。1H-NMRスペクトルは実施例6と一致した。

実施例8:4-[(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルスルフォニル]トルエンの合成

参考例1で合成した5ーヒドロキシー1ーメチルー3ートリフルオロメチルピラゾール1.7g(10mmol)と水酸化ナトリウム0.6g(15mmol)をトルエン10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、パラホルムアルデヒド1.7gを投入し、同温で24時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム1.8g(10mmol)を室温で投入し、8時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。更に水30mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水5mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物3.0g(収率88.2%)を淡黄色結晶として得た。1HーNMRスペクトルは実施例6と一致した。

実施例9:3-[(5-ヒドロキシ-1-フェニル-3-トリフル オロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルチオ]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチルイソオキサゾールの合成

参考例2で合成した、5ーヒドロキシー1ーフェニルー3ートリフルオロメチルピラゾール2.3g(10mmo1)と水酸化ナトリウム0.6g(15mmo1)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmo1)を滴下し、同温で1時間攪拌した(反応液1)。別に、水酸化ナトリウム1.2g(30mmo1)の水10mL溶液に[5,5ージメチル(4,5ージヒドロイソオキサゾロー3ーイル)]チオカルボキサミジン塩酸塩2.1g(10mmo1)を加え、1時間攪拌した(反応液2)。反応液1に反応液2を滴下し、2時間攪拌した(反応液2)。反応液1に反応液2を滴下し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸6.0g(60mm០1)を滴下した。トルエン20mLで2回、抽出操作を行い、得られたトルエン層を水10mL、飽和食塩水10mLで順次洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下、トルエンを留去し、表題化合物3.3g(収率89.2%)を粘性物質として得た。この粘性物質を、室温下、2日放置すると、結晶化した。

 1 H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ =7.3-7.7 (m, 4H), 4.90 (br, 1H), 4.16 (s, 2H), 2.92 (s, 2H), 1.37 (s, 6H) ppm、融点:89-92℃

実施例10:4-[(5-ヒドロキシ-1-フェニル-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルスルフォニル]ベンゼンの合成

参考例2で合成した、5-ヒドロキシ-1-フェニル-3-トリ

フルオロメチルピラゾール 2.3 g(10 mmol)と水酸化ナトリウム 0.6 g(15 mmol)を水10 mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7 g(20 mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、ベンゼンスルフィン酸ナトリウム 1.6 g(10 mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸 6.0 g(60 mmol)を滴下した。トルエン20 mLで2回、抽出操作を行い、得られたトルエン層を水10 mL、飽和食塩水10 mLで順次洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下、トルエンを留去し、表題化合物 3.4 g(収率 88.1%)を粘性物質として得た。この粘性物質を、室温下、2日放置すると、結晶化した。

¹ H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ =7.3-7.9 (m;10H), 4.91 (br,1H), 4.44 (s,2H), 3.63 (s,3H), 2.44 (s,3H) ppm、融点:122-123℃

実施例11:3-[(5-ヒドロキシー3-トリフルオロメチルピラゾロー4ーイル)-メチルチオ]-4,5-ジヒドロー5,5-ジメチルイソキサゾールの合成

参考例3で合成した、5ーヒドロキシー3ートリフルオロメチルピラゾール塩酸塩1.9g(10mmol)と水酸化ナトリウム1.2g(30mmol)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した(反応液1)。別に、水酸化ナトリウム1.2g(30mmol)の水10mL溶液に[5,5ージメチル(4,5ージヒドロイソオキサゾロー3ーイル)]チオカルボキサミジン塩酸塩2.1g(10mmol)を加え、1時間攪拌した

(反応液2)。(反応液1)に(反応液2)を滴下し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸6.0g(60mmol)を滴下した。ついで、炭酸水素ナトリウムを反応液のpHが7となるよう注意深く加えた。酢酸エチル20mLで2回、抽出操作を行い、得られたトルエン層を水10mL、飽和食塩水10mLで順次洗浄した。無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下、酢酸エチルを留去し、表題化合物2.4g(収率81.3%)を粘性物質として得た。この粘性物質を、室温下、2日放置すると、結晶化した。

 1 H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ = 5.35 (s;1H), 4.86 (br,1H), 4.10 (s,2H), 2.92 (s,2H), 1.39 (s,6H) ppm、LC-MS (EI):m/z=320 (M⁺), 163 (base)、融点: 131-133℃

実施例12:3-[(5-ヒドロキシ-3-トリフルオロメチルピラゾロ-4-イル)-メチルスルフォニル]トルエンの合成

参考例3で合成した、5ーヒドロキシー3ートリフルオロメチルピラゾール塩酸塩1.9g(10mmol)と水酸化ナトリウム1.2g(30mmol)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム1.8g(10mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。更に水20mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水10mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物2.67g(収率83.2%)を淡黄色結晶として得た。

 1 H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ = 7.62

(d; J=8.1 Hz, 2 H), 7.37 (d; J=8.1 Hz, 2 H), 5.34 (s; 1 H), 4.88 (s, 1 H), 4.34 (s, 2 H), 2.43 (s, 3 H) ppm、LC-MS(EI): m/z = 295 (M^+), 163 (base)、融点:130-133°C

実施例13:4-[(3-シアノ-5-ヒドロキシ-1-フェニル ピラゾロ-4-イル)-メチルスルフォニル]トルエンの合成

参考例5で合成した3-シアノ-5-ヒドロキシ-1-フェニルピラゾール1.8g(10mmol)と水酸化ナトリウム0.6g(15mmol)を水10mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、p-トルエンスルフィン酸ナトリウム1.8g(10mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。更に水20mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水20mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物3.0g(収率85.7%)を淡黄色結晶として得た。

 1 H-NMR値(300MHz, MeOH-d4): σ =7.4-7.7 (m;9H), 4.86 (s,1H), 4.40 (s,2H), 2.46 (s,3H) ppm、LC-M (EI):m/z=353 (M⁺), 197 (base)、融点:214℃

実施例14:4-[(3-カルボキシ-5-ヒドロキシ-1-フェ ニルピラゾロ-4-イル)-メチルスルフォニル]トルエンの合成 参考例4で合成した5-ヒドロキシ-1-メチル-3-エトキシ カルボニルピラゾール1.7g(10mmol)と水酸化ナトリウ

ム1.2g(30mmol)を水20mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.7g(20mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム1.8g(10mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸5.0g(50mmol)を滴下した。更に水30mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水20mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物2.6g(収率82.9%)を白色結晶として得た。

 1 H - N M R 値 (300 M H z , M e O H - d 4) : $\sigma = 7$. 5 2 (d; J = 8.1 Hz, 2 H) , 7 . 3 3 (d; J = 8.1 Hz, 2 H) , 4 . 8 5 (s, 2 H) , 4 . 6 1 (s, 2 H) , 3 . 6 5 (s, 3 H) , 2 . 4 2 (s, 3 H) p p m 、L C - M S (EI) : m / z = 310 (M^{+}) , 155 (base) 、融点 : 228 $^{\circ}$

実施例15:4-{[3-(2,4-ジクロロフェニル)-5-ヒ ドロキシ-1-メチルピラゾロ-4-イル]-メチルスルフォニル]トルエンの合成

参考例6で合成した3-(2, 4-ジクロロフェニル) -5-ヒドロキシー1-メチルピラゾール1.3g(5mmol)と水酸化ナトリウム0.3g(7.5mmol)をエタノール5mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液1.0g(11mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム0.9g(5mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸2.5g(25mmol)を滴下した。更に水15mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水10mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物2.1g(収率90.3%)を淡黄色結晶とし

て得た。

 1 H-NMR値(300MHz, CDCl₃): σ = 7.0-7.4 (m,7H),4.24 (s,2H),3.69 (s,3H),3.50 (br,1H),2.43 (s,3H) ppm、LC-MS(EI): m/z=410 [(M-1) +],255 (base)、融点:209℃

実施例16:4-{ [3-(3,5-ジニトロフェニル)-5-ヒドロキシー1-メチルピラゾロー4ーイル] ーメチルスルフォニル]トルエンの合成参考例4で合成した3-(3,5-ジニトロフェニル)ー5-ヒドロキシー1-メチルピラゾール0.65g(2.5mmol)と水酸化ナトリウム0.15g(3.8mmol)をエタノール5mLに溶解した。この溶液を室温で攪拌しながら、35%ホルマリン溶液0.5g(5.5mmol)を滴下し、同温で1時間攪拌した。これに、pートルエンスルフィン酸ナトリウム0.45g(2.5mmol)を室温で投入し、2時間攪拌した。反応後、35%塩酸2.5g(25mmol)を滴下した。更に水15mLを加え、析出した結晶を濾取した後、水10mLで2回洗浄した。温風乾燥機にて乾燥することにより、表題化合物0.9g(収率89.3%)を褐色結晶として得た。

 1 H − NMR値(300MH z, CDCl₃):σ = 8.88(t; J = 2.1 H z, 1 H), 8.52(d; J = 1.8 H z, 2 H), 7.55(d; J = 8.1 H z, 2 H), 7.16(d; J = 8.1 H z, 2 H), 4.43(s, 2 H), 3.85(b r, 1 H), 3.76(s, 3 H), 2.31(s, 3 H) p p m、LC − MS(E I):m/z = 432(M⁺),276(b a s e)、融点:192−194℃

産業上の利用可能性

5ーヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物の新規な工業的製造法が提供される。本発明の方法によれば、一般式(1)で表される5ーヒドロキシピラゾール化合物から、特殊な反応装置あるいは高価な触媒もしくは遷移金属を用いることなく、簡便な操作方法且つ穏やかな条件下で、単一工程で収率よく5ーヒドロキシー4ーチオメチルピラゾール化合物が生成する。しかも、触媒もしくは遷移金属に由来する有害な廃棄物も実質的に生成しないため、環境にも優しく、工業的な利用価値が高い。

また、溶媒として水を用いる態様によれば、更に環境にも優しく 、工業的な利用価値が高いものとなる。

請 求 の 範 囲

1. 一般式(1)

$$R_2$$
 N_N
OH
 OH
 OH

(式中、R₁ は水素原子、アルキル基、置換基を有しても良い芳香族炭化水素基、又は置換基を有しても良い複素環基を示し、R₂ は電子吸引性基を示す。)で表されるピラゾール類に、塩基及びホルムアルデヒドの存在下、一般式 (2)

(化2) $X-S(O)_p-R_3$ (2)

(式中、Xは水素原子又は金属を示し、R₃はアルキル基、置換基を有しても良い芳香族炭化水素基、又は置換基を有しても良い複素環基を示し、nは0又は2を示す。)で表される硫黄化合物を反応させることによる、一般式(3)

$$\begin{array}{ccc}
R_2 & S(O)_n - R_3 \\
N & OH \\
R_1
\end{array}$$
(3)

(化3)

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、nは、前記と同じ意味を示す。)で表される 5-ヒドロキシー 4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法。

- 2. nが0である、請求項1記載の5-ヒドロキシー4-チオメ チルピラゾール化合物の製造方法。
- 3. nが2である、請求項1記載の5-ヒドロキシー4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法。
- 4. R₂で表される電子吸引性基がトリフルオロメチル基である 、請求項1~3の何れか1項に記載の5-ヒドロキシー4-チオメ

チルピラゾール化合物の製造方法。

5. R₂で表される電子吸引性基がシアノ基である、請求項1~3の何れか1項に記載の5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法。

6. R₂で表される電子吸引性基がアルコキシカルボキシル基又はカルボキシル基ないしはその金属塩である、請求項1~3の何れか1項に記載の5-ヒドロキシ-4-チオメチルピラゾール化合物の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP	2005/006806
	CATION OF SUBJECT MATTER C07D231/20, 413/12		
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
B. FIELDS SE		totassification and if C	
Minimum docum	nentation searched (classification system followed by cla	assification symbols)	
${ t Int.Cl}^7$	C07D231/20, 413/12		
Jitsuyo		nt that such documents are included in t tsuyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2005
	ase consulted during the international search (name of d), CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)	ata base and, where practicable, search	terms used)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2004/014138 A1 (Kumiai Che Co., Ltd., Japan), 19 February, 2004 (19.02.04), (Family: none)	emical Industry	1-6
A	WO 2004/013106 A1 (Ihara Cher Co., Ltd., Japan), 12 February, 2004 (12.02.04), (Family: none)	mical Industry	1-6
A	WO 2003/000686 A1 (Kumiai Che Co., Ltd., Japan), 03 January, 2003 (03.01.03), & EP 1405853 A1 & US	emical Industry 2004259734 A1	1-6
× Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family	
02 May,	al completion of the international search , 2005 (02.05.05)	Date of mailing of the international sea 31 May, 2005 (31.0	
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2005/006806

	DOGULATIVES CONVENED TO THE THE THE	 2003/006806
). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	T
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	Relevant to claim No.
A	WO 2002/062770 A1 (Kumiai Chemical Indus Co., Ltd., Japan), 15 August, 2002 (15.08.02), & EP 1364946 A1 & US 2004110749	1-6
A	15 August, 2002 (15.08.02),	1-6

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.⁷ C07D231/20, 413/12

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.⁷ C07D231/20, 413/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

CA(STN), CAPLUS(STN), REGISTRY(STN)

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
A	WO 2004/014138 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Japan) 2004.02.19 (ファミリーなし)	1-6		
A	WO 2004/013106 A1 (Ihara Chemical Industry Co., Ltd., Japan) 2004.02.12 (ファミリーなし)	1-6		
A	WO 2003/000686 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Japan) 2003.01.03 & EP 1405853 A1 & US 2004259734 A1	1-6		

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献

の日の後に公表された文献

- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

国際調査を完了した日 02.05.2005	国際調査報告の発送日 31.5.2	200 5
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4 P 8 2 1 3
日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	渡辺 仁 電話番号 03-3581-1101 内:	線 3492

C (続き). 関連すると認められる文献 引用文献のカテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関語求の A W0 2002/062770 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Japan) 2002. 08. 15 & EP 1364946 A1 & US 2004110749 A1 1-6 A W0 2001/064651 A1 (Aventis CropScience SA, Fr.) 2001. 09. 07 & JP 2003-525275 A & EP 1263734 A1 & US 2001053854 A1 1-6	連する範囲の番号
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関語求の 請求の 請求の 1-6 A WO 2002/062770 A1 (Kumiai Chemical Industry Co., Ltd., Japan) 2002. 08. 15 & EP 1364946 A1 & US 2004110749 A1 1-6 A WO 2001/064651 A1 (Aventis CropScience SA, Fr.) 2001. 09. 07 & JP 1-6	連する 範囲の番号
2002. 08. 15 & EP 1364946 A1 & US 2004110749 A1 WO 2001/064651 A1 (Aventis CropScience SA, Fr.) 2001. 09. 07 & JP 1-6	